lotes

ゲルマネンの非対称な構造 Asymmetric structure of germanene

深谷 有喜 ナノスケール構造機能材料科学研究グループ Yuki Fukaya Research Group for Nanoscale Structure and Function of Advansed Materials

概要

最近、ポストグラフェンへの期待から、グラフェンの 炭素原子をより重い元素で置き換えた新しい原子シート の創製が試みられています。本研究では、全反射高速陽 電子回折(TRHEPD)¹と呼ばれる表面敏感な構造解析 手法を用いて、グラフェンのゲルマニウム版である"ゲ ルマネン"の原子配置を調べました。その結果、これま での予想に反し、ゲルマネンの原子配置の対称性が破れ ていることが明らかになりました。

本研究は、東京大学物性研究所(松田巌氏、Dr.Baojie Feng)、高エネルギー加速器研究機構物質構造科学研究 所(望月出海氏、兵頭俊夫氏)との共同研究で行われま した。本成果は、英国物理学会(IOP)の学術誌である 2D Materialsの9月8日付電子版に掲載されました。

1. 研究の背景・経緯

近年、炭素原子が蜂の巣状に配列したグラフェンが注 目されています。グラフェンは、原子1個分の厚みしか ない究極に薄い物質であるだけでなく、電流を高速で流 せることや極めて頑丈であるなど、これまでの物質には 見られない有用な性質を多く持っています。最近では、 ポストグラフェンへの期待から、グラフェンの炭素原子 をケイ素やゲルマニウム原子などで置き換えた"シリセ ン"や"ゲルマネン"と呼ばれる新しい原子シートの合 成も進められています。炭素原子より重い元素で原子 シートを作製すると、相対論効果によりスピン軌道相互 作用²が強く働き、グラフェンでは見られない新奇なス ピン物性の発現が期待されます[1]。さらにシリセンや ゲルマネンでは、結合性の違いから平坦なグラフェンと は異なり凹凸があるバックリング(座屈)構造³を形成 することが予想されています。バックリング構造が形成 されると、スピン軌道相互作用がさらに強められ、室温 付近で安定に動作するスピントロニクス材料としての期 待も高まります[1]。

グラフェンは、鉛筆の芯として知られる黒鉛(グラ ファイト)から一枚剥離したものに相当するため、いわ ば太古の昔から自然界に存在するものです。しかし、ケ イ素やゲルマニウムはダイヤモンド構造しか形成しない ため、シリセンやゲルマネンの母材となる物質が自然界 には存在しません。そのため、シリセンやゲルマネン は理論的な研究対象でしかありませんでした[2]。しか し、2012年に銀や二ホウ化ジルコニウムの表面上でシ リセンが合成できることが発見され[3-5]、これを契機に グラフェン以外の原子シートの研究が世界中で実施され るようになりました。最近ではシリセンだけでなく、ゲ ルマネンもいくつかの基板上で合成できることがわかり [6,7]、その基本情報である原子配置の解明が待たれてい



Abstract

Recently, in expectation of post-graphene, one has tried to fabricate novel atomic sheets that consist of heavier elements with keeping the honeycomb framework. In this study, we investigated the atomic configuration of "germanene", germanium version of graphene, using total-reflection high-energy positron diffraction (TRHEPD) technique. As a result, contrary to the previous results, we found that germanene has an asymmetric structure.

This work has been done in collaboration with Institute for Solid State Physics, The University of Tokyo (Dr.I. Matsuda and Dr.B. Feng) and Institute of Materials Structure Science, High Energy Accelerator Research Organization (KEK) (Dr.I. Mochizuki and Dr.T. Hyodo). The result was published in 2D Materials, Institute of Physics (IOP) publishing, on 8th September 2016.

1.Background

Nowadays, graphene, a honeycomb structure of carbon, has attracted increasing attention. Graphene is extremely thin (one atomic layer) and has many promising features such as very high carrier mobility and robust mechanical property. Very recently, silicon and germanium counterparts of graphene, which are respectively called "silicene" and "germanene", have been synthesized and investigated for post-graphene. Due to the strong spin-orbit coupling in the relatively heavier elements and the expected buckled configurations for the sp^3 bonding character, silicene and germanene are expected to possess more fascinating properties such as topological insulator [1].

In a sense, graphene exists in ancient times because graphite corresponds to a stack of graphene. For silicene and germanene, however, there are no parent materials like graphite for graphene because silicon and germanium form only the diamond structure. Hence, it was merely a theoretical subject [2]. In 2012, silicene has been successfully fabricated on the surface

ました。

グラフェンと同様に、シリセンやゲルマネンも原子1 個分の厚みしか持たないため、これらの原子配置を決定 するには、極めて薄い領域に高い感度を持つ実験手法が 必要になってきます。しかし通常の実験手法では、プロー ブする深さが原子10個分以上に達するため、目的とす る原子シートだけでなく、その下の支持基板からの情報 も多く含んでしまいます。このため、原子シートの原子 配置を高精度に決定することは容易なことではありませ ん。そこで私たちは、全反射高速陽電子回折(TRHEPD) [8] と呼ばれるプローブ領域を極限に抑えた構造解析手 法を開発し、様々な基板上のグラフェンとシリセンの原 子配置を実験的に解明してきました[9,10]。今回は、最 近合成が可能となったアルミニウム基板上のゲルマネン に着目しました[7]。

アルミニウム基板上のゲルマネンは、8個のゲルマニ ウム原子が1つのユニットとなって広く均一に敷き詰め られています[7]。これまでの報告では、ユニット内の8 個の原子の内、2個の原子が突出した左右対称な構造モ デルが提案されていました(Fig. 1の右)。しかしこれ はあくまで理論的な予想であり、実験的にはまだ確かめ られていませんでした。そこで私たちは、TRHEPD 法 を用いて詳細な原子配置を実験的に確定しようと考えま した。 of silver crystal and ZrB_2 thin film [3-5]. Its discovery opens a new field of atomic sheets. To date, germanene has been also fabricated on various substrates [6,7]. However, the atomic configurations of germenene had yet to be determined experimentally.

Because silicene and germanene have the thickness of only one atomic layer as well as graphene, there needs to be extremely high surface-sensitivity to determine the atomic configurations. However, conventional methods see not only the atomic sheet but also the underlying layer of the substrate. Thus, it is difficult to accurately determine atomic configurations of the atomic sheets without any effect from the substrate. We developed total-reflection high-energy positron diffraction (TRHEPD) technique having extremely high-surface sensitivity [8] and experimentally verified the atomic configurations of graphene and silicene on various substrates [9,10]. In this study, we focused on germanene on an aluminum substrate, which was just synthesized [7].

A uniform large-area germanene covers an aluminum substrate [7]. Eight Ge atoms are included in the unit cell (Fig. 1). In the previous studies, it was suggested that two Ge atoms in the unit cell are shifted upwards, leading to a symmetric structure (right of Fig. 1). However, the detailed atomic positions remained unknown. Thus, we tried to experimentally determine the atomic positrons using the TRHEPD technique.



Fig. 1

今回決定したアルミニウム基板上のゲルマネンの原子配置(左)とこれまでに予想されていた原子配置(右)。黄色と橙色の丸はどち らもゲルマニウム原子であり、灰色の丸はアルミニウム原子である。原子配置の対称性を強調するために、上に突出したゲルマニウム 原子を大きな黄色の丸で描いている。

Fig. 1

(left) Atomic configuration of germanene on an aluminum substrate determined in this study and (right) the previous structure model. Yellow and orange circles denote the Ge atoms. Gray ones are the Al atoms. To highlight the symmetry of the atomic configuration, the Ge atoms shifted upwards are denoted by large yellow circles.

2. 研究の内容

今回実験に使用した TRHEPD 法では、10 keV のエ ネルギーを持つ陽電子⁴ビームを試料表面にすれすれの 角度で入射させ、そこから反射した陽電子の強度分布を 回折パターンとして観測します (Fig. 2)。陽電子の強度 分布を解析すると、試料の原子配置を決定することがで きます。ここで、陽電子は電子とは逆のプラスの電荷を 持つため、同じプラスの電荷を持つ原子核から強い反発 力を受けます。したがって、陽電子が物質に入射すると 常に押し返される力が働くため、物質中の深い領域には 侵入することができません。特に、すれすれ入射の場合 には全反射⁵が起き、その時の強度分布には物質の最表 面だけの原子配置の情報が反映されます。全反射の臨界 角を少し超えた場合には、最表面直下の原子層の情報も 得られます。いずれの場合にも、物質内部の情報は含ま れません。このため、ノイズの原因となる物質内部の情 報に邪魔されることなく、最表面近傍の原子配置を高精 度に決定できます。今回私たちは、先行研究で報告され たレシピ[7]に倣ってアルミニウム基板上にゲルマネン を合成し、TRHEPD 実験を行いました [11]。

その結果、これまでの予想に反して、ゲルマネンの原 子配置が左右対称でないことがわかりました[11]。これ までの報告のような左右対称な原子配置[7]だとすると、 陽電子ビームの入射方向に対して左右それぞれに反射し た陽電子の強度分布は同じ形状になります(Fig. 3の青 線)。しかし実際に測定した結果では、左右の強度分布 が同じではありませんでした(Fig. 3の白丸)。詳細な 強度解析の結果(Fig. 3の黒線)、ユニット内の8個の 原子の内、1個の原子だけが突出した左右非対称な構造 であることがわかりました(Fig. 1の左)。

今回、原子シートの構造決定を得意とする TRHEPD 法により、ゲルマネンの原子配置の詳細が初めて明らか になりました。なお、今回の結果は、これまでに構造以 外について報告されている実験結果と矛盾しないことも わかりました。

2.Contents of the study

For TRHEPD, the positron beam with an energy of 10 keV is incident on a sample surface at grazing angle, and the diffraction pattern is observed on a screen (Fig. 2). The spot intensities in the diffraction pattern contain information about atomic configurations of the sample. Therefore, by means of the intensity analysis, we are able to determine the atomic positions of the sample. Since the positron, antiparticle of the electron, has a positive charge, opposite to that of the electron, it feels an intense repulsive force from nuclei of a point charge. Owing to the repulsive force, the positron beam cannot penetrate deeper region of the sample. Especially, the total reflection takes place at low glancing angles. Under the total reflection condition, the diffraction intensity contains information about only the outermost layer of the material. Therefore, the TRHEPD method enables us to perform accurate structure determinations without any effect from the deeper bulk region. In this study, we fabricated the germanene on an aluminum substrate after the recipe [7] and conducted TRHEPD experiments [11].

As a result, we found that the germanene on the aluminum substrate has an asymmetric structure, contrary to the symmetric one of the previous report [7]. Assuming the symmetric structure as reported in the previous studies (right of Fig. 1), the intensity distributions of positrons scattered to left and right should show the same shape (blue lines in Fig. 3). However, the intensity distributions measured in this study show the different shapes (open circles in Fig. 3). From the intensity analysis based on the dynamical diffraction theory (black lines in Fig. 3), it was found that one Ge atom in the unit cell is shifted upwards, giving rise to an asymmetric structure (left of Fig. 1).



Fig. 2

TRHEPD の実験配置図。10 keV のエネルギーを持つ陽電子ビームを試料表面 に入射し、スクリーン上で回折パターンを観測する。

Fig. 2

Experimental setup of TRHEPD. The positron beam with an energy of 10 keV is incident on the sample surface and the diffraction pattern is observed on a screen.



Fig. 3

アルミニウム基板上のゲルマネンからの陽電子の反射強度。上と下の曲線は、陽電子 ビームの入射方向に対してそれぞれ左と右に反射した陽電子の強度分布である。丸は 今回の実験値である。黒線と青線はそれぞれ非対称な原子配置(図1の左)と対称な 原子配置(図1の右)を用いた計算値である。

Fig. 3

Diffraction intensity of positrons for germanene on an aluminum substrate. Top and bottom curves show the intensity distributions of positrons scattered to left and right, respectively. Open circles indicate the experiment. Black and blue lines are the calculations using the asymmetric (left of Fig. 1) and symmetric (right of Fig. 1) structures of germanene, respectively.

3. 成果の意義と波及効果

原子配置は、物質の性質を決める最も基本的なパラ メータです。今回、ゲルマネンの原子配置の詳細が実験 的に明らかになったことにより、これまで不明であった ゲルマネンの物性の理解が急速に進むことが期待されま す。また、ゲルマネンはスピントロニクス材料としても 有望視されています。今後は、省エネ・小型・高速デバ イスの開発に向けた、ゲルマネンの応用研究が進むこと も期待されます。

4. 今後の予定

最近では、周期表でゲルマニウムの一つ下に位置する スズの原子シート(スタネンと呼ばれている)の合成の 可能性も報告されています。また超伝導研究においても、 鉄系超伝導体(FeSe)の原子シートの合成が可能となり、 転移温度が著しく上昇するといった非常に興味深い報告 もされています。今回の研究のように、原子シートの原 子配置は予期せぬ変位をし、それが物性変化の重要な起 源となる可能性が十分にあります。今後は、原子シート の構造決定を得意とする TRHEPD 法を用いて、これら の興味深い原子シートの原子配置を実験的に明らかにし ていく予定です。 In this study, we verified the asymmetric structure of germanene on the aluminum substrate with the aid of the surface sensitivity of the TRHEPD technique. Moreover, it was found that our model can also explain the previous experimental data.

3. Importance of the result and its impact

Atomic positions are the most fundamental parameter to determine the properties of matter. Our result will promote a better understanding of the properties of germanene. As mentioned in the background section, germanene has a potential application for spintronics materials. Developments towards the realization of energy-saving and high-speed devices will make progress.

4.Perspectives

Very recently, a tin counterpart of graphene, which is called "stanene", has been successfully synthesized. Moreover, the atomic sheet of FeSe superconductors leads to a dramatic increase in the transition temperature (up to about 60 K). In the near future, we will experimentally verify the atomic positions of such atomic sheets using the TRHEPD technique.

参考文献 References

- [1] C.-C. Liu, et al., Phys. Rev. Lett. **107**, 076802 (2011).
- [2] K. Takeda and K. Shiraishi, Phys. Rev. B 50, 14916 (1994).
- [3] P. Vogt, et al., Phys. Rev. Lett. 108, 155501 (2012).
- [4] C.-L. Lin, et al., Appl. Phys. Express 5, 045802 (2012).
- [5] A. Fleurence, et al., Phys. Rev. Lett. 108, 245501 (2012).
- [6] M. E. Dávila, et al., New J. Phys. 16, 095002 (2014).
- [7] M. Derivaz, et al., Nano Lett. 15, 2510 (2015).
- [8] Y. Fukaya, et al., Appl. Phys. Express 7, 056601 (2014).
- [9] Y. Fukaya, et al., Carbon 103, 1 (2016).
- [10] Y. Fukaya, et al., Phys. Rev. B 88, 205413 (2013).
- [11] Y. Fukaya, et al., 2D Mater. 3, 035019 (2016).

用語の説明

1. 全反射高速陽電子回折(TRHEPD)

TRHEPD は、Total-Reflection High-Energy Positron Diffraction の略称。TRHEPD 法は、1992 年に理論的に 提唱(A. Ichimiya, Solid State Phenom. **28-29**, 143 (1992)) され、1998 年に放射性同位体の陽電子線源を用い た装置が開発(A. Kawasuso and S. Okada, Phys. Rev. Lett. **81**, 2695 (1998)) された、原子力機構発の実験手法 である(当時は、RHEPD 法と呼ばれていた)。2012 年に高 エネルギー加速器研究機構と共同で、電子線形加速器を用い た新しい TRHEPD 装置を開発した。これにより、これまで の約 100 倍増の陽電子ビーム強度を得ることに成功し、実験 精度が飛躍的に向上した。

2. スピン軌道相互作用

電子は、電流の担い手となる電荷と磁気の源となる"スピン"の特性を持つ。最近、スピンを積極的に利用したスピントロニクスが注目されており、そこではスピン軌道相互作用が重要な駆動力となる。一般的に重い原子になるほど、相対論効果によりスピン軌道相互作用が強く働く。

3. バックリング (座屈)構造

炭素原子はお互いに 120°の結合角を持って結合しやすいた め、グラフェンは平坦な構造となる。一方、ケイ素やゲルマ ニウム原子では 120°より小さい角度で結合しやすいため、シ リセンやゲルマネンでは部分的に原子が突出したバックリン グ(座屈)構造を形成することが予想される。

4. 陽電子

電子の反粒子。電子と同じ質量、電荷、スピンを持つが、 電荷の符号は電子とは逆のプラスである。陽電子は電子と出 会うと対消滅するが、その確率は100万分の1と極めて小さ いため、TRHEPD実験では対消滅の効果を考えなくてよい。

5. 全反射

光や粒子が物質の表面で透過することなく全て反射される こと。特に陽電子の全反射では、0.5-1.0Å 程度の極めて浅い 領域(原子1個分に相当)にしか侵入しない。